

В Новосибирске разработали первую российскую лазерную систему для производства микросхем. Установка работает на ультрафиолетовом излучении с длиной волны 257 нанометров и предназначена для создания фотошаблонов — ключевых элементов при изготовлении электронных компонентов.

Система состоит из лазера мощностью 10-30 милливатт и волоконного усилителя, повышающего мощность до 15 ватт. Особенностью разработки стал кристалл для преобразования частоты излучения, что обеспечивает высокую точность печати. По словам создателей, аналогов этому оборудованию в России пока не существует.

Главные преимущества новинки — низкое энергопотребление (всего 1 ватт) и полная независимость от иностранных комплектующих. Предсерийный образец уже проходит испытания на белорусском предприятии «Планар», где производят массовые микросхемы.

Разработка принадлежит компании «Оптические технологии», резиденту новосибирского Академпарка. Технопарк.